



(19)中華民國智慧財產局

(12)設計說明書公告本

(11)證書號數：TW D232106 S

(45)公告日：中華民國 113 (2024) 年 07 月 01 日

(21)申請案號：112304974

(22)申請日：中華民國 112 (2023) 年 09 月 26 日

(51)LOC.(13)Cl.：15-99

(30)優先權：2023/03/30 日本

2023-006489

(71)申請人：日商荏原製作所股份有限公司 (日本) EBARA CORPORATION (JP)

日本

(72)設計人：田嶋一喲 TAJIMA, KAZUHIRO (JP)；柏木誠 KASHIWAGI, MAKOTO (JP)；古澤

磨奈人 FURUSAWA, MANATO (JP)

(74)代理人：林志剛

(56)參考文獻：

CN 305643632

CN 306017243

JP D1601552

KR DM/102525

US D895076

US D977677

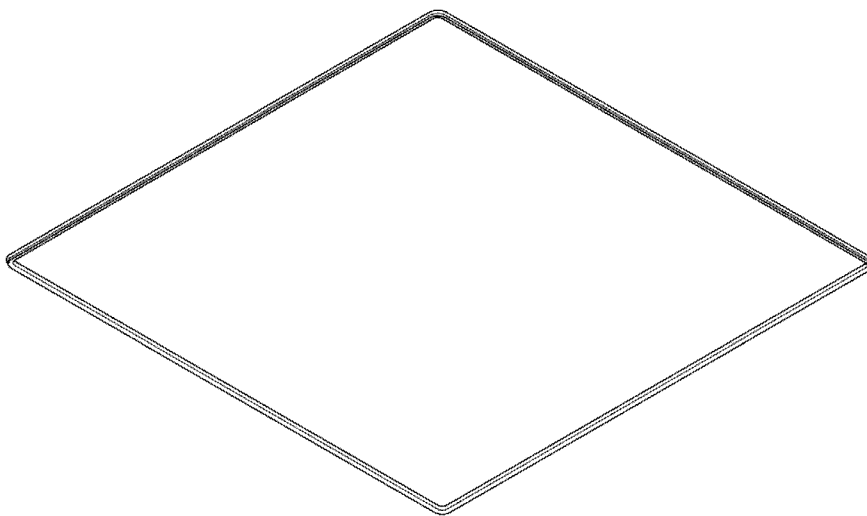
審查人員：黃少瑜

圖式數：10 共 6 頁

(54)名稱

化學性機械研磨裝置用密封材

代表圖：



【立體圖】



公告本

D232106

【設計說明書】

【中文設計名稱】 化學性機械研磨裝置用密封材

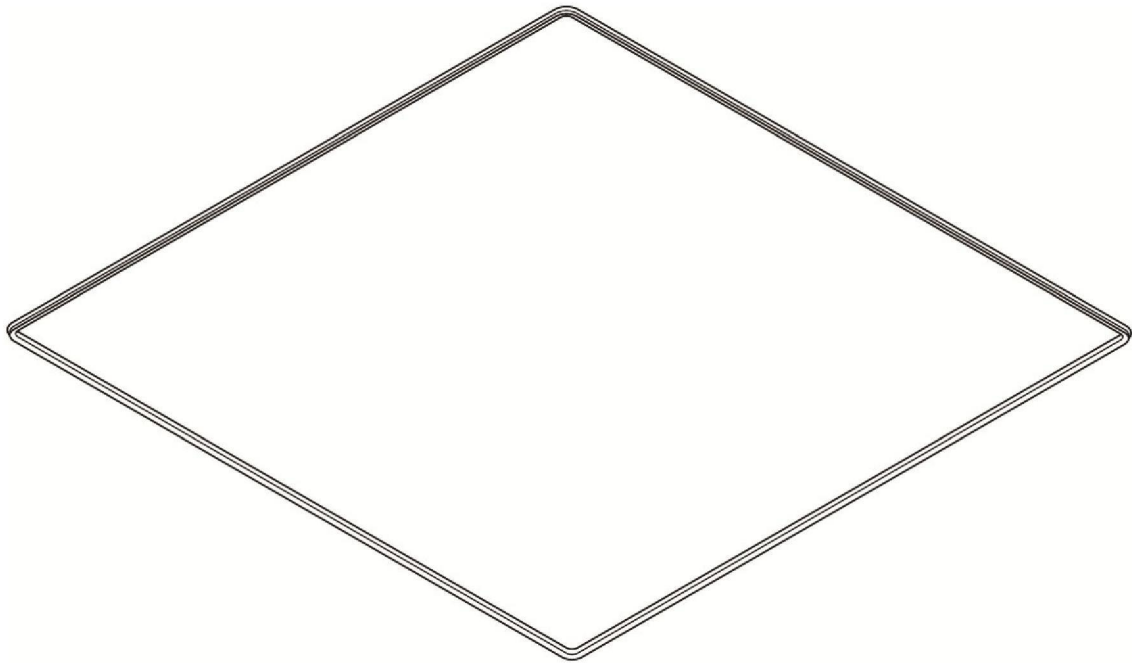
【物品用途】

【0001】 本設計的物品係化學性機械研磨裝置用密封材，是在化學性機械研磨(CMP)裝置中使用在供保持四邊形基板之頂環的密封材。

【設計說明】

(無)

【設計圖式】
(指定代表圖)



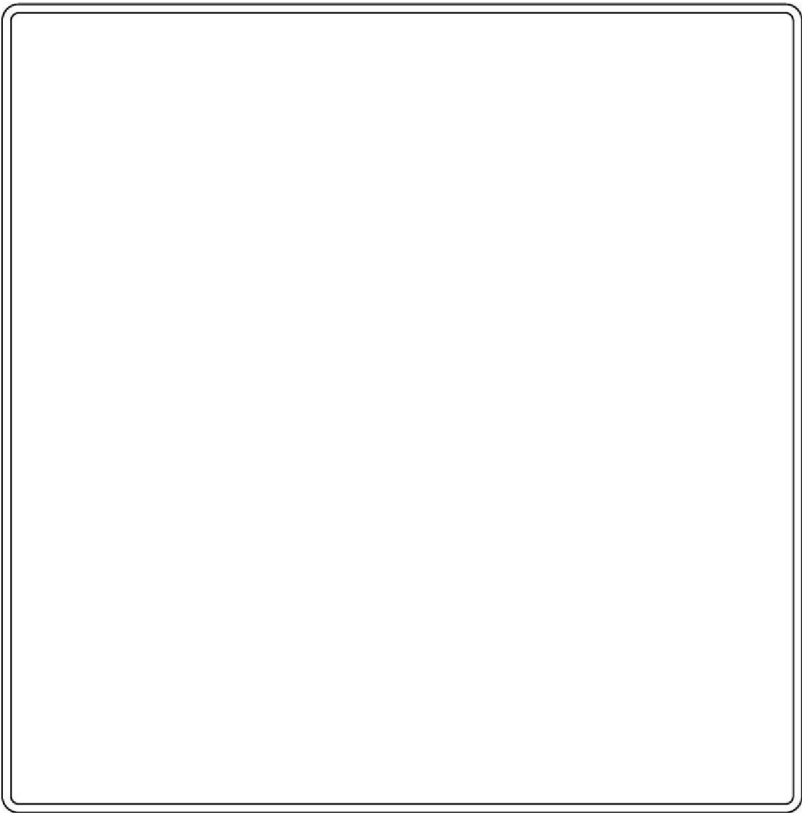
【立體圖】



【前 視 圖】



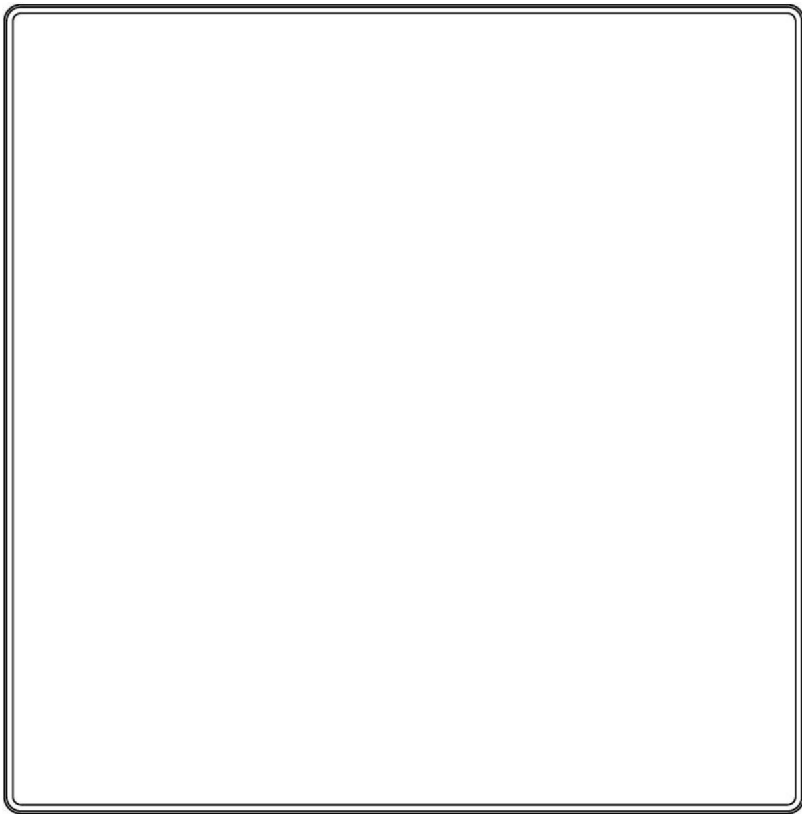
【後 視 圖】



A
↑

A
↑

【俯 視 圖】



【仰 視 圖】



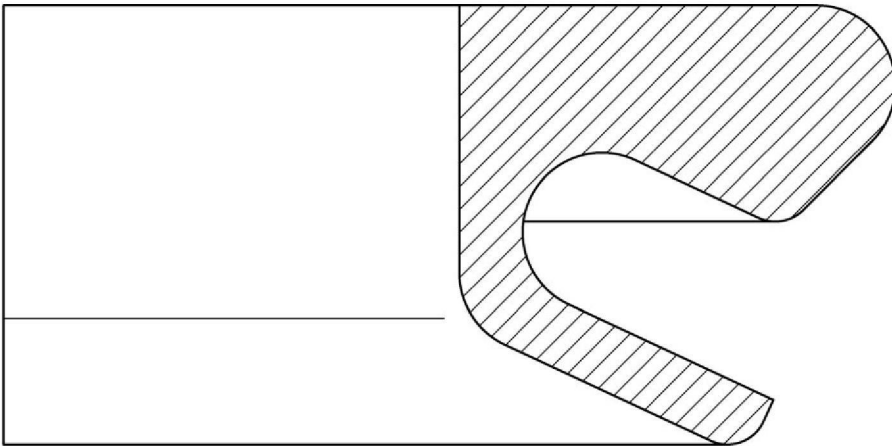
【左 側 視 圖】



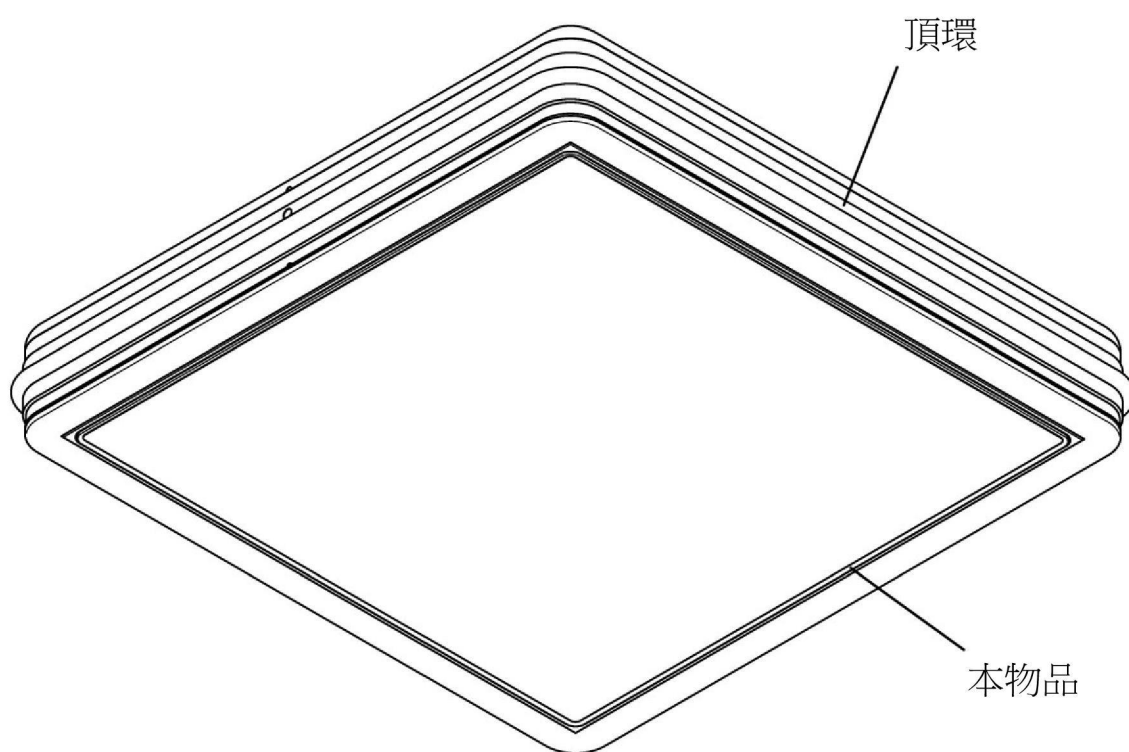
【右 側 視 圖】



【A-A 剖面放大圖】



【B 部放大圖】



【使用狀態參考圖】